

진행파형 반도체 광증폭기에서 이득포화 및 잡음특성의 활성층 구조 의존성

Structural dependence of a gain saturation and noise figure in a traveling-wave semiconductor optical amplifier

장세윤, 심종인, 이정석*, 김호인*, 윤인국*, 김승우*, 신현철*, 어영선
한양대학교 전자전기제어계측공학과, 삼성전자 광통신연구소*

seyoonj@giga.hanyang.ac.kr

Abstract

The optical gain saturation and noise figure characteristics of 1550nm traveling-wave semiconductor optical amplifiers are analyzed experimentally and theoretically. The result shows that there is an optimum active layer thickness for high saturation output power and low noise figure.

1. 서 론

반도체 광증폭기는 다른 광소자들과 집적이 가능하고, 증폭파장대역이 넓어 WDM 광통신용 소자로서 각광을 받고 있다. 반도체 광증폭기의 주요특성으로는 광증폭이득, 이득포화특성, 잡음특성등이 있다.^[1] 반도체 광증폭기에 의한 잡음이 신호와 함께 증폭될 경우 왜곡된 신호가 전송되므로, 반도체 광증폭기의 잡음특성이 좋아야하며, 잡음특성의 개선을 위해 광증폭이득 및 이득 포화특성에 대한 정확한 이해가 선행되어야 한다. 본 논문에서는 충분한 광증폭이득과 이득포화특성 그리고 낮은 잡음특성을 얻기에 적합한 공진기의 구조를 찾기 위하여, TMM (Transfer Matrix Method)을 이용한 simulation 결과와 제작한 광증폭기의 측정결과를 비교함으로써 simulator를 검증하고, 포화이득 및 잡음특성과 활성층의 구조와의 관계를 밝혔다.

2. 광증폭 이득의 이론적 고찰

SOA의 물질이득은 에너지 변화에 따라 parabolic 형태의 근사를 취함으로써 다음과 같은 형식으로 모델링할 수 있다.^[1]

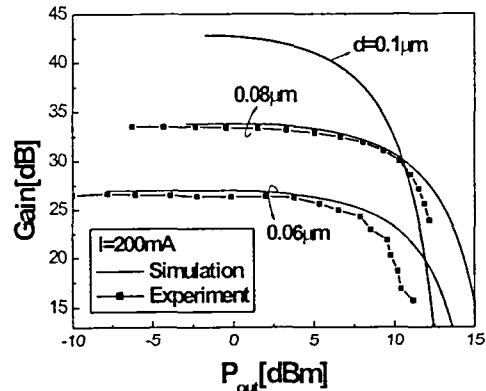
$$g_m(N, \lambda) = \frac{a_0(N - N_0) - a_1(\lambda - \lambda_p)^2 - a_3(\lambda - \lambda_p)^3}{1 + 2 \cdot \varepsilon \cdot S_{\text{photon}}} \quad \text{식(1)}$$

식(1)는, 에너지에 따른 물질이득을 계산하는 식으로 a_0 , a_1 , a_2 , a_3 는 이득상수, λ_p 는 피크파장, ε 은 nonlinear 이득상수이다. 물질이득은 피크값으로부터 파장의 변화에 따라 점차 작아지며, 이득포화를 고려하기 위해 nonlinear 이득상수가 적용되었다.

$$P_{ASE} = \frac{h \cdot c \cdot \Delta\omega}{\lambda} \cdot \frac{(1 - R_2^2) \cdot n_{sp} \cdot g_{AVE}}{\left| \frac{1 - R_1 \cdot R_2 \cdot \exp(2 \cdot \gamma \cdot \Delta z)}{\exp(\gamma \cdot \Delta z)} \right|^2} \int_{z_1}^{z_2} |P_{sp}(z)|^2 dz \quad \text{식(2)}$$

$$NF \approx \frac{2P_{ASE,out}}{Ghv} + \frac{1}{G} \quad \text{식(3)}$$

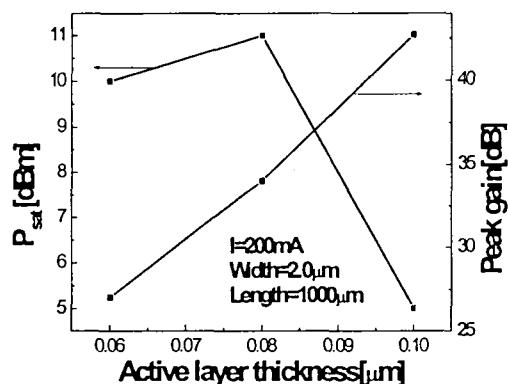
식(2)는 ASE power를 계산하기 위한 수식으로, spontaneous emission에 의한 광전력($P_s(z)$)과 입출력단의 반사율(R_1, R_2), 그리고 inversion factor(n_{sp})를 고려하였다. 식(3)은 ASE power로부터 noise figure를 계산하기 위한 수식으로 ASE power에 비례하고, 이득에 반비례하는 모습을 보인다. 축방향으로 불균일한 이득분포를 고려하기 위해 공진기의 길이를 n개의 영역으로 나누고, 각 영역에서의 이득, 굴절률, 캐리어 분포등의 parameter는 일정하다고 가정하고 TMM(Transfer Matrix Method)을 사용하였다.



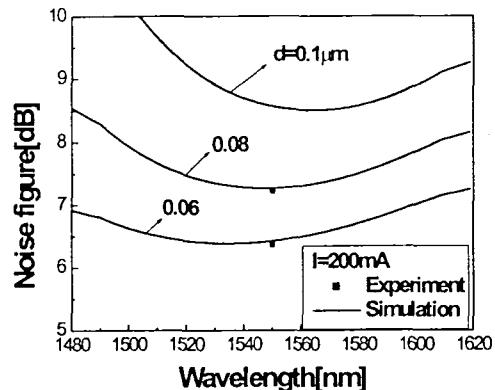
[그림1] 구조에 따른 이득포화특성

3. 실험결과

[그림1]은 구조에 따른 이득포화현상을 나타내었다. 활성층의 두께가 두꺼우면 이득이 크고, 포화이득은 증가하다가 감소한다. 이와같은 현상을 [그림2]에서 나타내었다. 이것은 활성층 구조가 거점에 따라 광가동계수가 커져 이득이 커지지만, 활성층 내부 포톤의 증가로 인해 이득포화현상이 빨리 발생하기 때문이다. [그림3]은 활성층 두께에 따른 noise figure를 나타내었다. 활성층의 두께가 두꺼울수록 spontaneous emission에 의한 전력이 증가하므로 noise figure는 커진다.



[그림2] 활성층두께에 따른 이득포화특성



[그림3] 활성층 두께에 따른 noise figure

4. 결 론

TMM에 의해 계산된 반도체 광증폭기의 이득포화특성으로부터 활성층의 길이가 1000μm일때 두께 0.08μm에서 적당한 이득과 포화전력 및 잡음특성을 얻을 수 있었다. 이와같은 결과는 제작된 SOA에 의한 실험결과와 같은 경향을 보였다.

5. 참고문헌

- [1] H. Ghafouri-Shiraz, "Fundamentals of laser diode amplifiers," John Wiley & Sons, 1996.